

Germany-Bonn: Industrial machinery
OJ S 75/2017 15/04/2017
Contract notice
Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Deutsche Forschungsgemeinschaft e. V., Zentrale Beschaffungsstelle

Postal address: Kennedyallee 40

Town: Bonn

NUTS code: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt

Postal code: 53175

Country: Germany

Contact person: Deutsche Forschungsgemeinschaft

E-mail: Boris.Licker@dfg.de

Telephone: +49 2288852105

Fax: +49 2288853676

Internet address(es):

Main address: www.dfg.de

I.2. Information about joint procurement

The contract is awarded by a central purchasing body

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/wgi/zentrale_beschaffungsstelle/index.html

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Other type: e.V.

I.5. Main activity

Other activity: Forschungsförderung

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Beschaffung einer Ätzanlage.

Reference number: STA 1426/2-1 (A 739)

II.1.2. Main CPV code

42000000 Industrial machinery

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Inductively Coupled Plasma (ICP) Ätzsystem mit Vakuumschleuse

Beschafft werden soll eine erprobte Anlage, welche u.a. zur Nanostrukturierung von III-V Verbindungshalbleitern geeignet ist.

Die ICP Quelle und ICP Plasmakammer sollen für kleine Wafer bis max. 50 mm Durchmesser optimiert sein.

Die Anlage muss im RIE Mode und im ICP Mode betrieben werden können.

Substrat-Elektrode geeignet für Bruchstücke und bis zu 200 mm Wafer (ohne Umbauten)

Elektrodotemperatur regelbar (-30 bis + 80° C)

Platzbedarf des Systems < = 170 cm x 65 cm

Das Angebot soll umfassen:

Vakuumsystem

Separater Gas Pod für max. 8 MFC-kontrollierte Gaslinien

Vakuumschleuse

Laserinterferometer zur Endpunkterkennung

Systemsteuerung per Software

Sonstiges

Das System muss den relevanten aktuell gültigen Normen, Zertifizierungen und Standards entsprechen

Der Hersteller soll gute Prozessunterstützung gewährleisten können

Gesetzliche Gewährleistung

Lieferung frei Verwendungsstelle.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEG03 Jena, Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: Universität Jena.

II.2.4. Description of the procurement

Inductively Coupled Plasma (ICP) Ätzsystem mit Vakuumschleuse

Beschafft werden soll eine erprobte Anlage, welche u. a. zur Nanostrukturierung von III-V Verbindungshalbleitern geeignet ist

Prozesskammer

Aluminiumkammer aus einem vollen Al-Block gefräst

Pumpen Flansch > = 200 mm für sehr hohes effektives Saugvermögen

> = 40 mm Flansch mit Sichtfenster + zusätzlicher seitlicher Port.

Systemdesign inkl. Plasmaquelle und Pumpsystem voll radialsymmetrisch, um beste Gleichmäßigkeit über einen großen Parameterbereich zu gewährleisten.

ICP-Plasmakammer Innendurchmesser 50-80 mm.

Elektrische Kammerheizung bis mind. 80°C

Substrat-Elektrode

> = 200 mm, geeignet für Bruchstücke und bis zu 200 mm Wafer

Helium-Rückseiten-Kühlung (softwaregesteuert) mit mechanischer Klemmung

Klemmvorrichtung für Wafer (2“) inklusive
 Elektrodentemperatur regelbar (softwaregesteuert) im Bereich -30 bis + 80° C
 Max. Substrat-Dicke: bis zu 10 mm incl. Carrier
 Das Prozessieren von Substraten bis 200 mm Durchmesser und Bruchstücken muss ohne Umbauten möglich sein.
 Plasmaquellen
 Substrat-Elektrode
 Leistung 300 W, 13,56 MHz
 Aluminium-Dunkelraumschild auf Massepotential
 ICP Quelle optimiert für kleine Wafer bis max. 50 mm Durchmesser
 ICP-Typ: helical
 ohne kapazitive Komponente d.h. mit (entfernbarer) elektrostatischer Abschirmung
 ICP-Keramik: Aluminiumoxid
 Die Anlage muss ohne mechanische Änderungen im RIE Mode und im ICP Mode betrieben werden können.
 Leistung > = 600 W (13.56 MHz)
 Beide Einheiten zur automatischen Hochfrequenzabstimmung (AMU) müssen über zwei mit Schrittmotoren gesteuerte Vakuumkapazitäten verfügen.
 Reflektierte Leistung < 2 % der Vorwärtsleistung
 Beide AMUs müssen direkt an die ICP Quelle bzw. Substratelektrode gekoppelt sein.
 Vakuumsystem
 Turbomolekular- Pumpe geeigneter Bauart
 Elektrische Heizung des Pumpstutzens
 Bitte als Option anbieten: Trockenläuferpumpe geeigneter Bauart (Reaktivgasbeständig mit N2-Spülung) und Saugleistung
 Separater Gas Pod für max. 8 MFC-kontrollierte Gaslinien
 5 MFC-gesteuerte Gasleitungen, davon 2 mit Bypass und intern metallgedichteten MFC, eine davon elektrisch beheizt
 Gaslinien innen und außen elektropoliert und orbitalgeschweißt, Verschraubungen nur VCR
 Vakuumschleuse
 Vakuumschleuse mit kleinem Volumen < 6 Liter
 Außenabmessungen lateral max. 30 cm x 50 cm
 Aluminiumkammer aus einem vollen Al-Block gefräst
 Großes oberes Sichtfenster (mind. 200 mm Durchmesser)
 Interchamber Ventil VAT MonoVAT
 Turbo mit mind. 70 l/s Saugleistung
 Eigene Trockenpumpe mit >= 15 m³/ h
 Pirani- und Penning-Röhren zur Vakuummessung
 Laserinterferometer
 Laserinterferometer (675 nm Wellenlänge, vollständig in die Systemsteuerung und Datalogging integriert, Endpunkterkennung mittels Intensität und 1. Ableitung, manueller x/y Tisch (Fahrbereich 10 mm in x und 10 mm in y Richtung), integrierte Kamera)
 Systemsteuerung
 Die komplette Anlage soll von einem PC (Bevorzugtes Betriebssystem: Windows 10) gesteuert werden
 MESC
 Das System muss den MESC-Standard erfüllen.
 Die Anlage sollte dem 200 mm SEMI-MESC-Standard entsprechen.
 Sicherheit, CE
 Das System muss die aktuell gültige CE-Norm erfüllen, insbesondere

EN13849

Maschinenrichtlinie – 2006/42/EG

Niederspannungsrichtlinie – 2006/95/EG

EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Umwelt

Nachweis von Maßnahmen zur Umweltverträglichkeit, z B die ISO 14001:2004 Zertifizierung
Abmessungen

Platzbedarf des Systems < = 170 cm x 65 cm

(ohne Vorpumpen, PC, heater/ chiller, Gas Pod)

Sonstiges

Besuch eines Prozessspezialisten (mind. 3 Tage vor Ort) zum Prozessnachweis und Training

Service vor Ort

12 Monate Gewährleistung Lieferung frei Verwendungsstelle.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Technischer Wert / Weighting: 50

Price - Weighting: 50

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 3

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: yes

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Es handelt sich um einen einmaligen Lieferauftrag OHNE Laufzeiten, das Formular erfordert in diesem Feld jedoch eine Eingabe.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Anzahlungen bis zur Höhe von max. 50 % des Kaufpreises werden nur gegen unbefristete Bankbürgschaft nach deutschem Recht geleistet.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Competitive procedure with negotiation

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.5. Information about negotiation

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 14/05/2017

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

Date: 26/05/2017

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Das Aktenzeichen entsprechend Ziff. II.1.1) ist bei sämtlicher Korrespondenz anzugeben.

Die vollständigen Unterlagen für den Teilnahmewettbewerb sind hier veröffentlicht.

Weitergehende Auftragsunterlagen werden mit der Angebotsaufforderung nach dem Schlusstermin für Teilnahmeanträge versendet.

Beim Schlusstermin laut Ziff. IV.2.2) handelt es sich um den Schlusstermin für den Eingang der Teilnahmeanträge (nicht für den Eingang der Angebote). Vor Ablauf des Schlussterns gemäß Ziff. IV.2.2) werden keine Verdingungsunterlagen versendet.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer des Bundes

Postal address: Villemomber Straße 76

Town: Bonn

Postal code: 53123

Country: Germany

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Das GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) verpflichtet uns, Sie zu gegebener Zeit über die beabsichtigte Auftragsvergabe zu informieren. Hiergegen haben Sie die Möglichkeit, innerhalb einer festgelegten Frist vor der Vergabekammer des Bundes, zu klagen. Im Falle einer fristgerechten Klage erbitten wir eine entsprechende Information.

VI.5. Date of dispatch of this notice

13/04/2017